

2027年3月期 第2四半期
決算説明資料

（2026年4月1日～2026年9月30日）

2026年11月11日
ジーエルテクノホールディングス株式会社

東証STD 255A

GLTECHNO HOLDINGS

01. エグゼクティブサマリー … P. 3

02. 決算概要（2027年3月期 第2四半期）

連結 … P. 6

セグメント別 … P. 8

03. 業績・配当予想（2027年3月期） … P. 24

04. IRに関連する情報発信・取り組み … P. 30

05. APPENDIX … P. 32

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

01. エグゼクティブサマリー

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

2027年3月期 第2四半期

増収・増益

売上高

24,639 百万円

（前年同期比 ＋15.2%）

半導体事業および分析機器事業が売上を牽引し、前年同期比増収

営業利益

3,849 百万円

（前年同期比 ＋35.2%）

主に半導体事業による増収効果が寄与し、前年同期比増益

2027年3月期 業績予想及び配当予想

通期業績予想を上方修正
配当予想は据え置き

売上高

50,000 百万円（前期比 ＋6.0%） → 上方修正 → **53,290 百万円**（前期比 ＋12.9%）

営業利益

7,740 百万円（前期比 ＋ 8.8%） → 上方修正 → **8,220 百万円**（前期比 ＋ 15.6%）

配当予想

据え置き **126 円**

（前期比 ＋3円）

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

分析機器事業

増収・増益

- ✓ PFAS分析関連の消耗品販売に加え、装置販売も堅調に推移し、増収
- ✓ 増収効果のほか、前期の新生産棟の設備移設費用が一巡したこともあり、増益

売上高

9,629 百万円

前年同期比 +7.1%

営業利益

786 百万円

前年同期比 +22.2%

半導体事業

増収・増益

- ✓ 豊富な受注残高と工場の高稼働率を背景に、増収
- ✓ 増収効果に加え、生産効率が向上したことにより営業利益率も改善し、増益

売上高

14,211 百万円

前年同期比 +23.8%

営業利益

3,048 百万円

前年同期比 +41.0%

自動認識事業

減収・減益

- ✓ 自社製品群は順調に推移したものの、OEM製品群の需要が伸び悩み、減収
- ✓ 売上低迷の影響を受け、2Q単体(7-9月)では回復基調にあるものの、上期累計では減益

売上高

798 百万円

前年同期比 ▲13.2%

営業利益

7 百万円

前年同期比 ▲71.8%

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

02. 決算概要（連結）

2027年3月期 第2四半期

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

増収・増益

- 売上高は、半導体事業の豊富な受注残高を背景に工場の稼働率が高水準で推移し業績に大きく貢献、分析機器事業も堅調に推移し、前年同期比15.2%の増収
- 営業利益は、主力2事業の増収効果に加え、特に半導体事業にて生産効率が向上したことから、前年同期比35.2%の増益

単位：百万円	2026年3月期2Q		2027年3月期2Q		前年同期比	
	実績	売上比率	実績	売上比率	増減率	増減額
売上高	21,383	-	24,639	-	+15.2%	+3,255
売上原価	14,049	65.7%	15,799	64.1%	+12.5%	+1,749
売上総利益	7,333	34.3%	8,839	35.9%	+20.5%	+1,505
販管費	4,487	21.0%	4,989	20.3%	+11.2%	+502
営業利益	2,846	13.3%	3,849	15.6%	+35.2%	+1,003
経常利益	3,225	15.1%	3,735	15.2%	+15.8%	+509
親会社株主に帰属する中間純利益	2,160	10.1%	2,510	10.2%	+16.2%	+349

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

02. 決算概要（セグメント別）

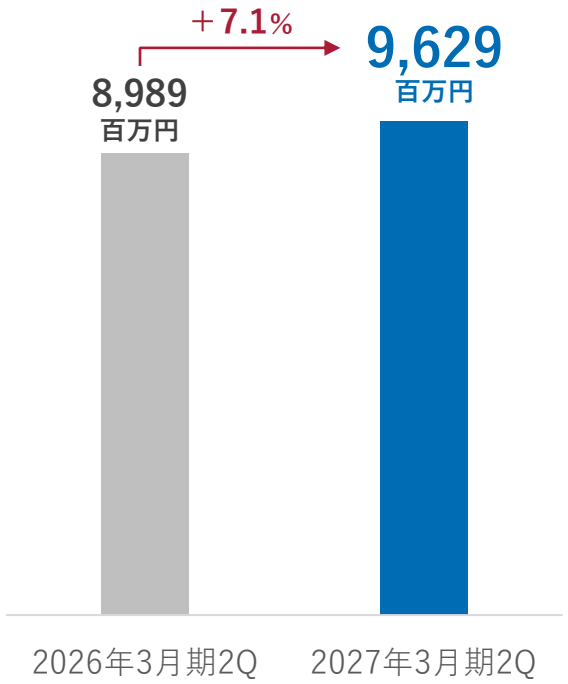
2027年3月期 第2四半期

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

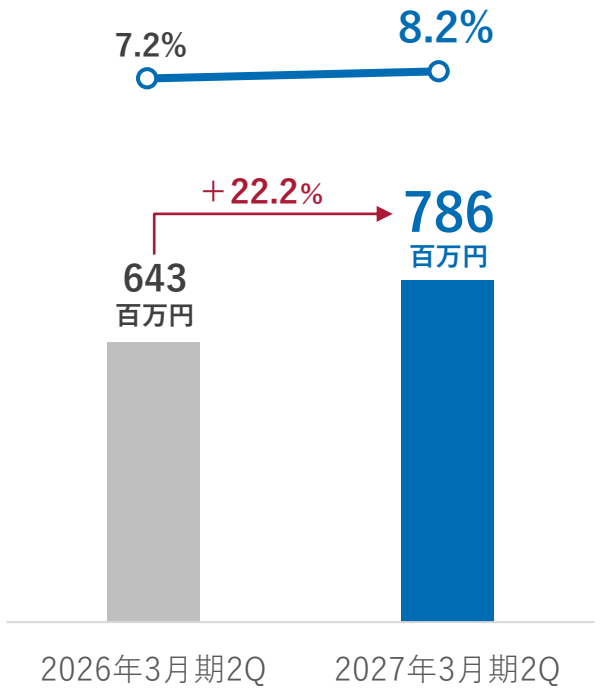
増収・増益

- **売上高は、PFAS分析関連の消耗品販売に加え、装置販売も堅調に推移し、前年同期比7.1%の増収**
- **営業利益においては、増収効果のほか、前期における新生産棟の設備移設費用が一巡したこともあり、前年同期比22.2%の大幅な増益**

売上高



営業利益（率）



要因・その他

国内　売上高比率 74.1%

装置類： **環境分析・製薬企業向けが堅調。**質量分析計や水質分析用の固相抽出関連装置、ガスクロマトグラフ用周辺機器などの売上が好調に推移。

消耗品： 今年４月からの**有機フッ素化合物（PFAS）に関する水質検査の義務化を背景**に、固相抽出カートリッジや試料調製容器、各種部品類の販売が牽引。

海外　売上高比率 25.9%

- **主力製品である液体クロマトグラフ用カラムの販売が堅調に推移**、ガスクロマトグラフ用周辺機器や固相抽出を含む前処理関連装置の売上も増収。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

増収効果と消耗品売上が伸長したことなどにより、売上総利益率が1pt改善

単位：百万円	2026年3月期2Q 実績	2026年3月期2Q 売上比率※1	2027年3月期2Q 実績	2027年3月期2Q 売上比率※1	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
売上高						
外部売上高※2	**8,989**	-	**9,629**	-	＋7.1％	＋640
内部売上高※3	**0**	-	**-**	-	▲0.0％	▲0
計	**8,989**	-	**9,629**	-	＋7.1％	＋640
売上原価	**5,312**	59.1％	**5,594**	58.1％	＋5.3％	＋282
売上総利益	**3,677**	40.9％	**4,035**	41.9％	＋9.7％	＋358
販管費	**3,033**	33.7％	**3,249**	33.7％	＋7.1％	＋215
営業利益	**643**	7.2％	**786**	8.2％	＋22.2％	＋142

※1 合計の売上高に対する比率
※2 外部顧客への売上高
※3 セグメント間の内部取引高又は振替高

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

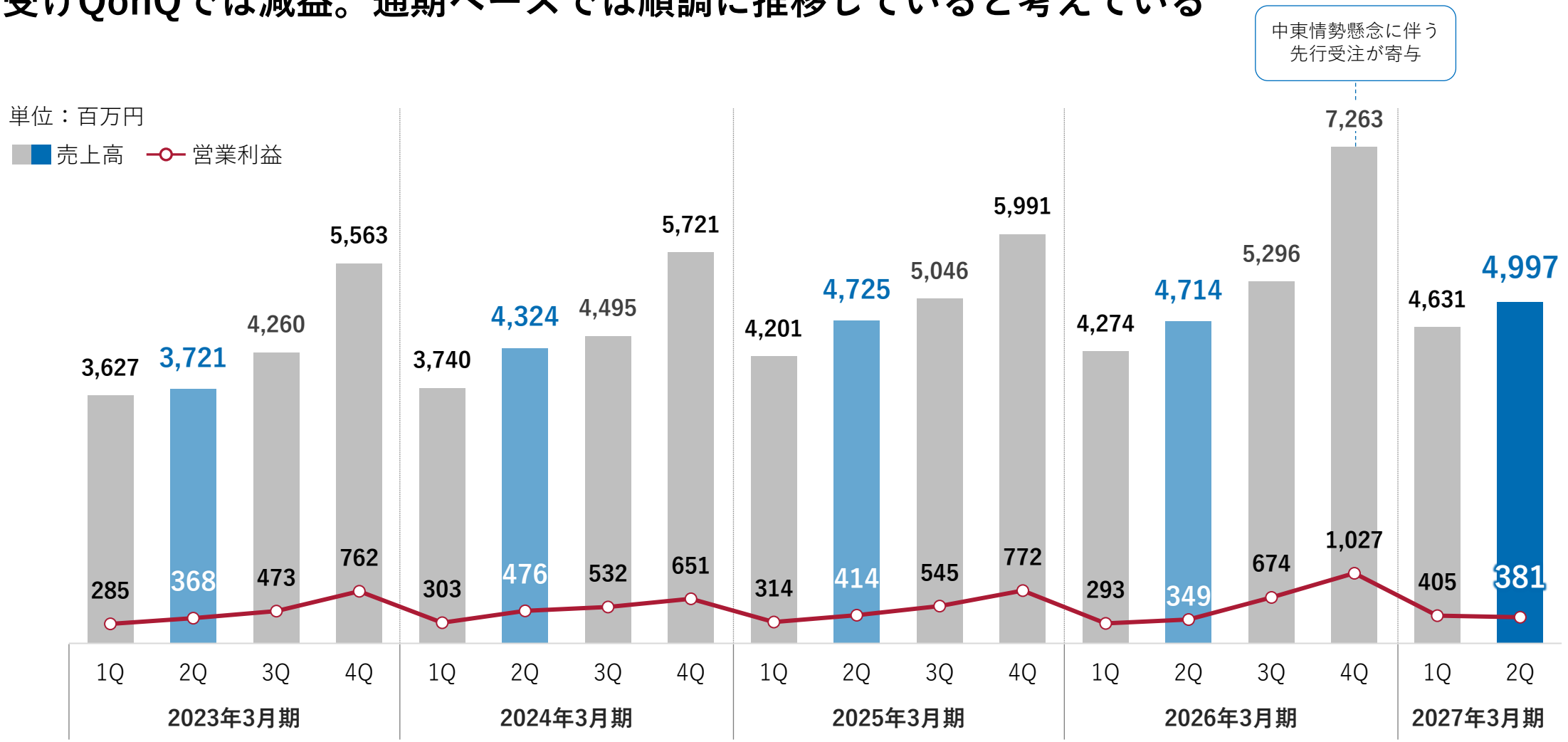
1Qに続き、全ての地域にて堅調に推移し、前年同期比増収

単位：百万円	2026年3月期 2Q	2027年3月期 2Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額	2027年3月期 2Q 構成比
国内	6,769	7,134	+5.4%	+365	74.1%
海外	2,220	2,495	+12.4%	+275	25.9%
北米	253	338	+33.3%	+84	3.5%
中国	753	810	+7.5%	+56	8.4%
シンガポール	27	40	+49.7%	+13	0.4%
その他のアジア	606	649	+7.0%	+42	6.7%
その他の地域	578	656	+13.6%	+78	6.8%
合計（国内+海外）	8,989	9,629	+7.1%	+640	100.0%

※ 前連結会計年度において、「アジア」に含めておりました「中国」と「シンガポール」につきましては、金額的重要性が増したため、当連結会計年度から独立掲記しております。
※ 前連結会計年度の「アジア」に表示していた1,388百万円は、「中国」753百万円、「シンガポール」27百万円、「その他アジア」606百万円に組み替えております。

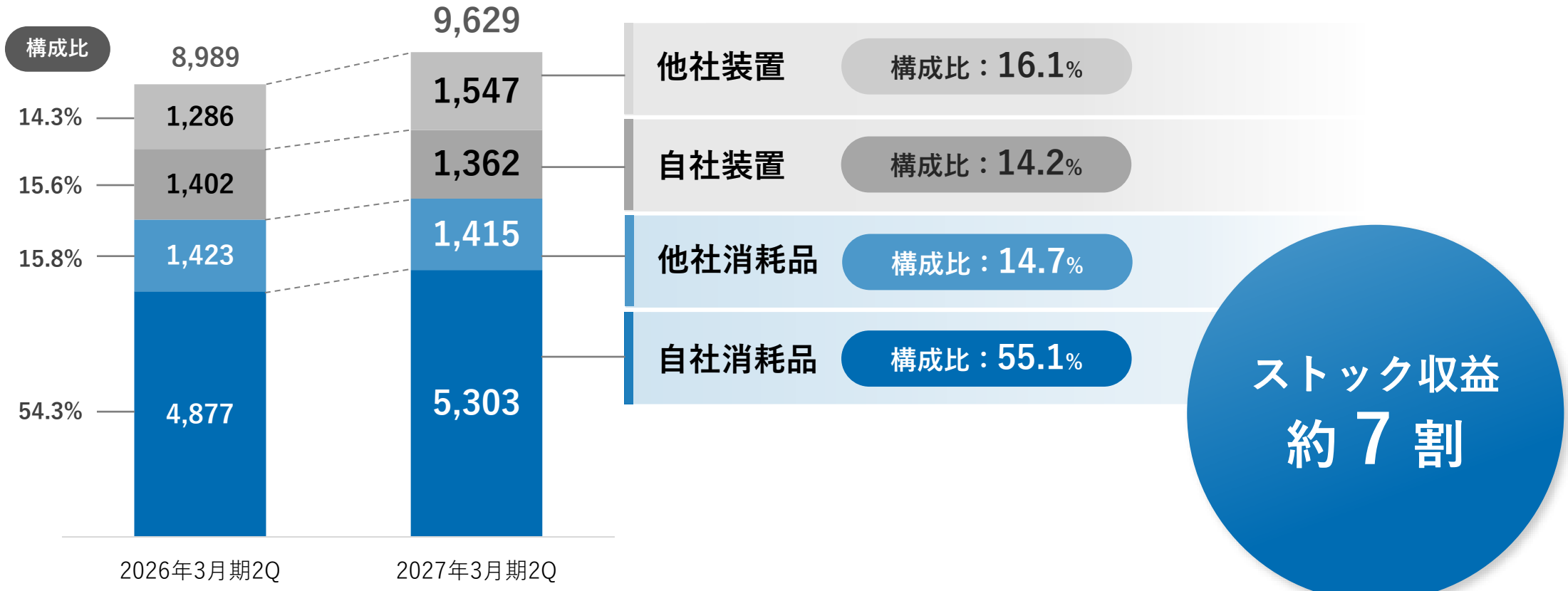
© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

売上高は堅調に推移。営業利益については、自社消耗品の販売が例年よりも1Qにやや集中した影響を受けQonQでは減益。通期ベースでは順調に推移していると考えている



自社消耗品を中心とするストック収益が売上高の約7割を占め、高水準かつ安定した収益構成を継続

単位：百万円



自社の強み・コア技術を活かし、市場トレンドを捉えた新製品を着実に市場投入

装置

全自動固相抽出装置 AquaTrace AE9600

- 水質分析の前処理を全自動化し、業務を効率化
- 工程間の待ち時間を削減しスループットを向上
- １日当たりの処理検体数を拡大

主な分野 環境・水質



POINT

PFAS分析向け対応
AquaTrace AE9600-B

試料水流路における
フッ素樹脂の使用を極力
抑制したPFAS分析向け
モデルをラインアップ

パージ・トラップ濃縮導入装置 PT9000



- 水中のVOCの分析に対応
- 制御ソフト連携が可能になり操作性が向上

主な分野 環境・水質

マイクロチャンバー捕集装置 MC4230



- 自動車内装材のVOC、食品の香気成分などの分析に対応
- ISO規格に準拠し、複数検体を迅速に評価

主な分野 自動車関連・内装材

消耗品

液体クロマトグラフ用カラム

Inertsil Hybrid-Z HILIC
Inertsil Hybrid-Si HILIC
InertCore PFP



主な分野 ライフサイエンス
食品・飲料

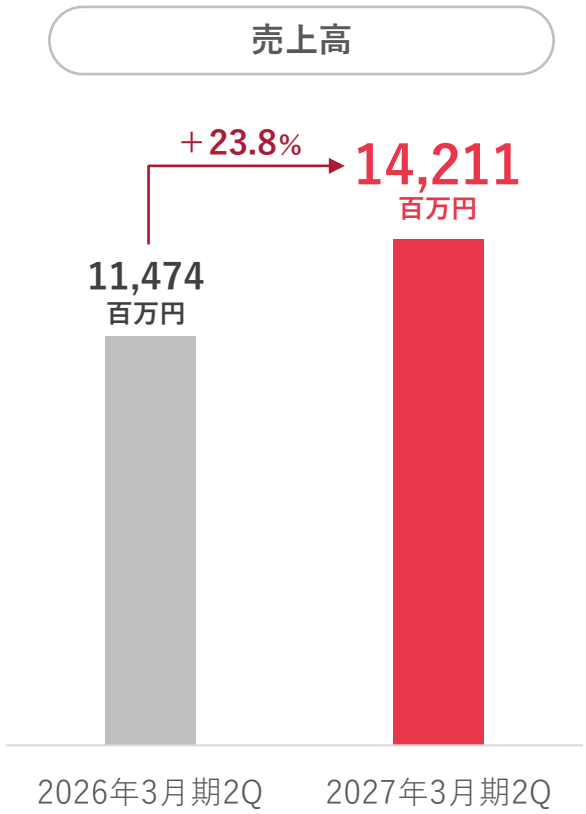
ラインアップを増やして
多様な分析のニーズに対応

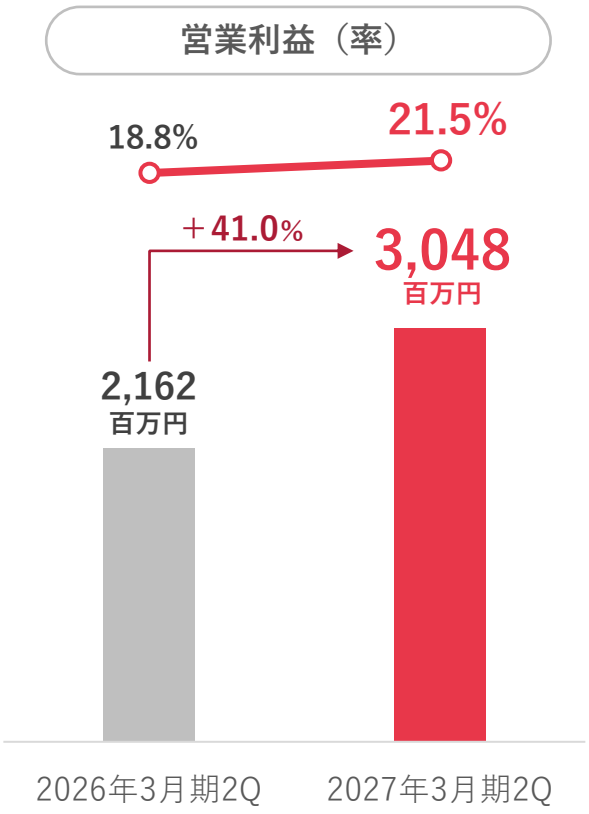
※ 一部の新製品は、日本国内のみ先行販売しております。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

増収・増益

- 売上高は、豊富な受注残高と工場の高稼働率を背景に、前年同期比23.8%の増収
- 営業利益は、増収効果と工場の高稼働に伴い生産効率が向上し、前年同期比41.0%の大幅増益





要因・その他

＜需要継続＞

- **AI向けデータセンターや生成AI関連製品の需要の拡大**を背景に、当社製品に対する**需要も継続。**
- 半導体メーカー各社の旺盛な設備投資需要に支えられ、**受注高は高水準を維持**し、豊富な受注残高と工場の高稼働により**売上高は計画を上回り推移。**

＜今後の需要拡大に向けた対応＞

- **新規需要の掘り起こし**や、**高付加価値製品**の開発と拡販によるマーケットの拡大。
- 国内外での**増産体制**構築のための準備。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

売上高の前年同期比23.8%増に加え、工場の高稼働により売上原価率が改善し、営業利益は前年同期比41.0%増の大幅増益

単位：百万円	2026年3月期2Q 実績	2026年3月期2Q 売上比率※1	2027年3月期2Q 実績	2027年3月期2Q 売上比率※1	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
売上高						
外部売上高※2	**11,474**	-	**14,211**	-	+23.8%	+2,736
内部売上高※3	**1**	-	**0**	-	▲41.4%	▲0
計	**11,476**	-	**14,212**	-	+23.8%	+2,736
売上原価	**8,124**	70.8%	**9,717**	68.4%	+19.6%	+1,592
売上総利益	**3,351**	29.2%	**4,495**	31.6%	+34.1%	+1,143
販管費	**1,189**	10.4%	**1,446**	10.2%	+21.5%	+256
営業利益	**2,162**	18.8%	**3,048**	21.5%	+41.0%	+886

※1 合計の売上高に対する比率
※2 外部顧客への売上高
※3 セグメント間の内部取引高又は振替高

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

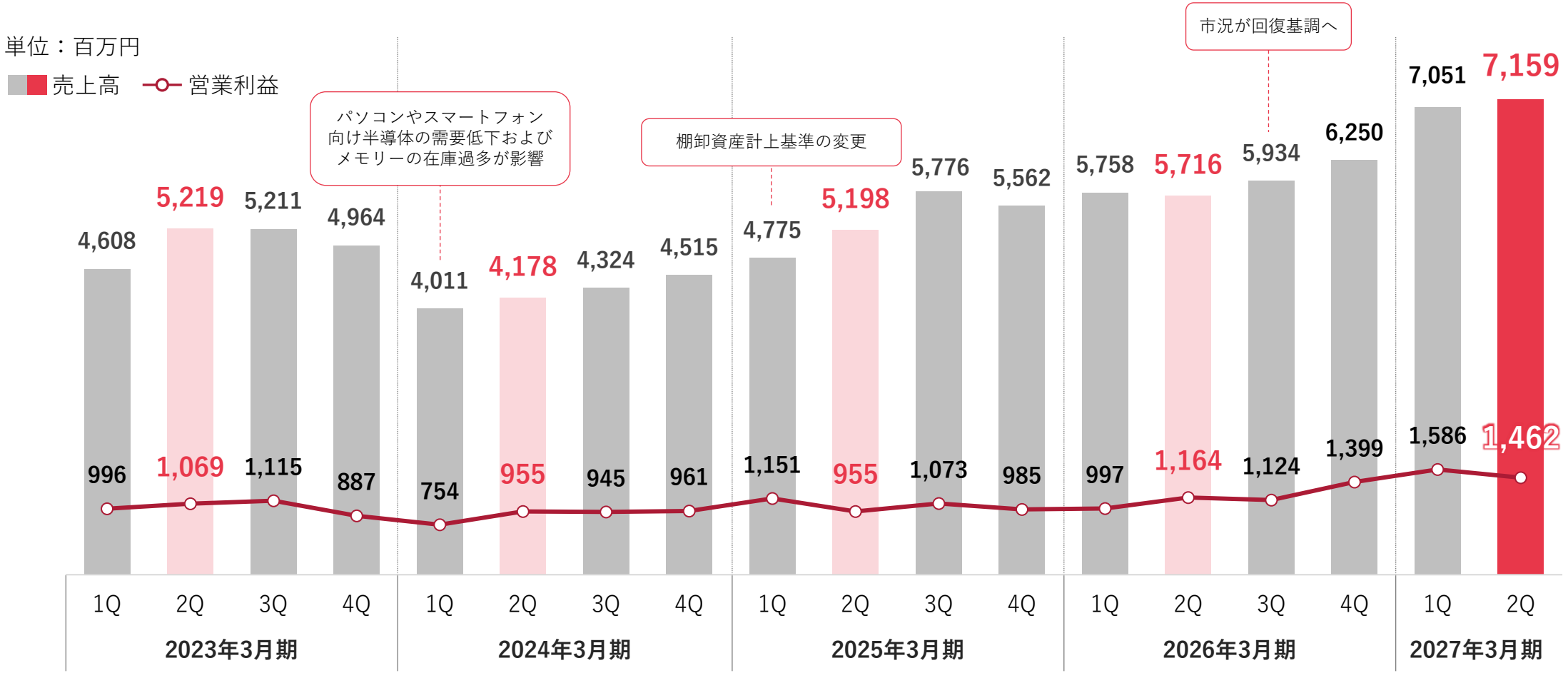
国内外ともに増収。特にシンガポール向けの需要拡大が全体成長を牽引。
国内売上高についても前年同期比11.9%増となり、国内向けの需要も増加傾向

単位：百万円	2026年3月期 2Q	2027年3月期 2Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額	2027年3月期 2Q 構成比
国内	4,259	4,767	+11.9%	+508	33.5%
海外	7,215	9,444	+30.9%	+2,228	66.5%
北米	530	691	+30.3%	+160	4.9%
中国	1,855	1,897	+2.3%	+41	13.3%
シンガポール	3,522	5,474	+55.4%	+1,951	38.5%
その他のアジア	1,283	1,350	+5.2%	+67	9.5%
その他の地域	23	30	+31.5%	+7	0.2%
合計（国内+海外）	11,474	14,211	+23.8%	+2,736	100.0%

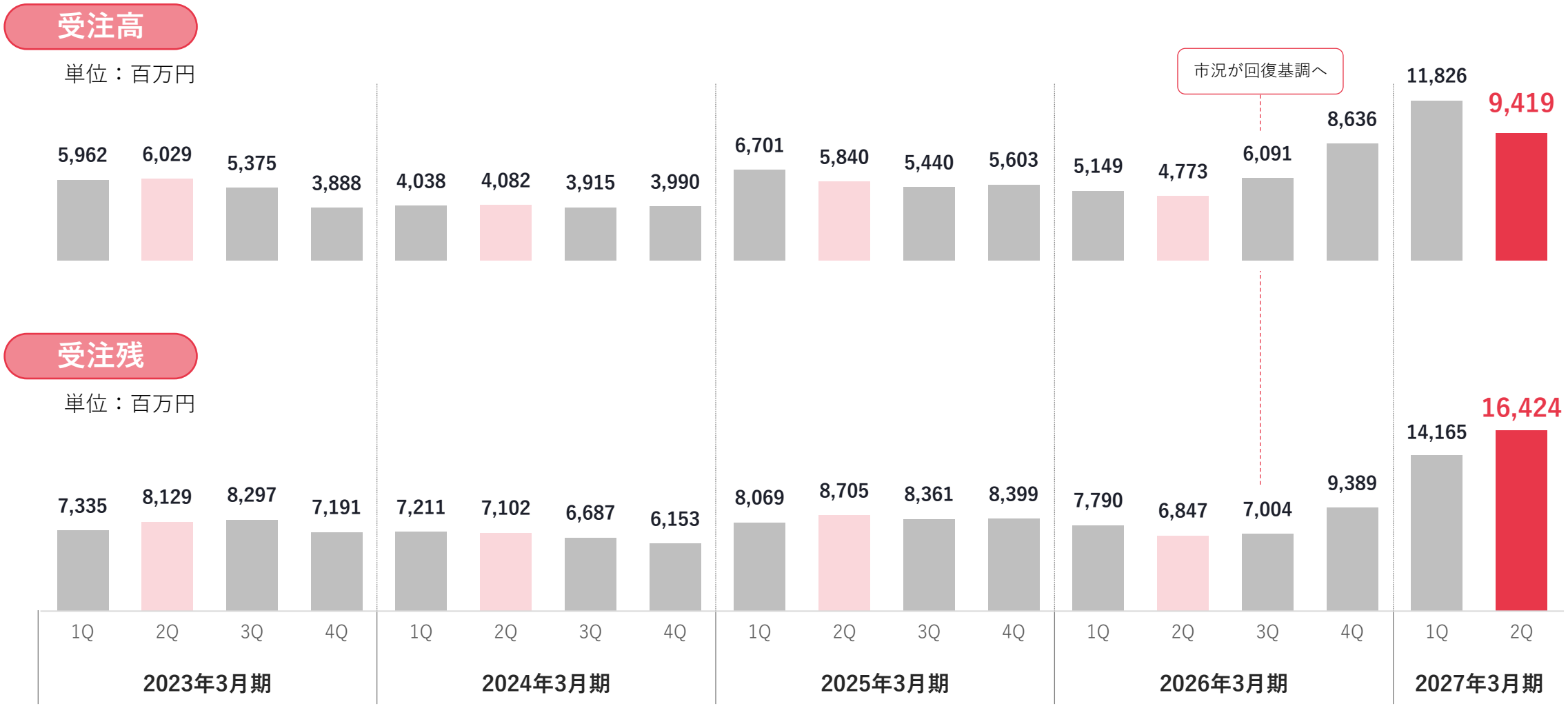
※ 前連結会計年度において、「アジア」に含めておりました「中国」と「シンガポール」につきましては、金額的重要性が増したため、当連結会計年度から独立掲記しております。
※ 前連結会計年度の「アジア」に表示していた6,661百万円は、「中国」1,855百万円、「シンガポール」3,522百万円、「その他アジア」1,283百万円に組み替えております。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

1Qに続いて工場は非常に高い稼働率を維持。営業利益は、喜多方の新生産棟の減価償却費計上、およびベトナム新工場の稼働準備に伴う費用などにより1Qと比較して低下

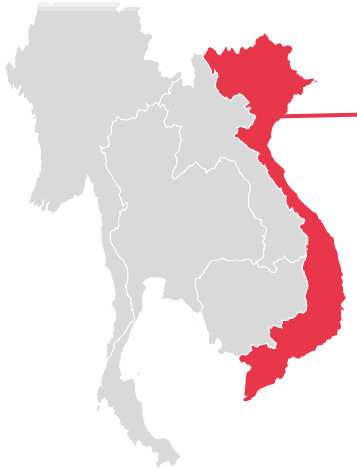


先行受注はやや落ち着いたものの受注高は比較的高い水準を維持、それに伴い受注残高はさらに増加



© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

2027年1月の操業開始に向けて順調に進捗





ベトナム新工場の概要

目的	半導体需要の拡大に伴う供給体制強化
敷地面積	27,474.7㎡
延床面積	16,144.08㎡
生産能力	年間売上高ベースで30億円以上（完全稼働時）

2025年6月	2025年7月	2026年1月	2026年11月	2027年1月
新会社設立	土地取得	新工場建設工事開始	設備搬入開始	操業開始予定

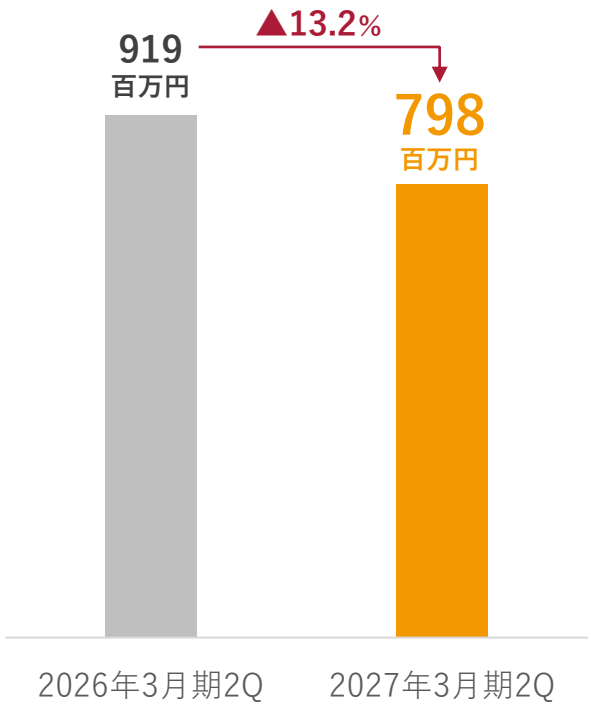
→ 完全稼働へ

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

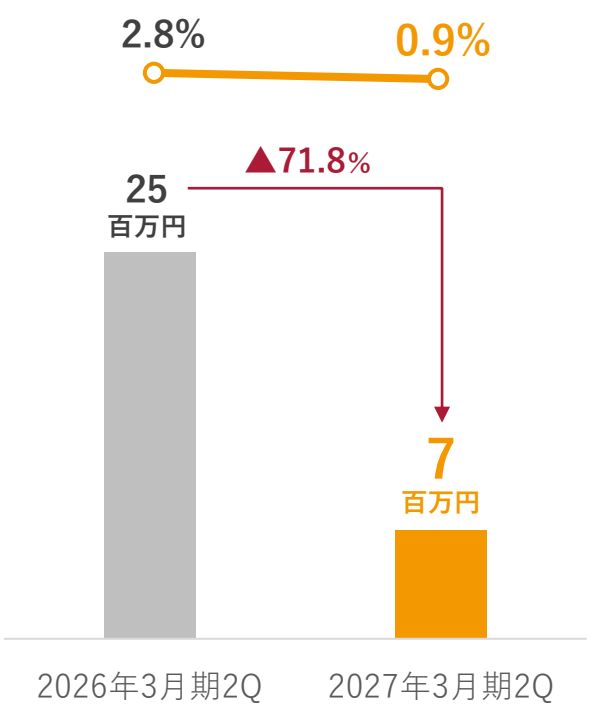
減収・減益

- 売上高は、自社製品群は順調に推移したものの、OEM製品群の需要が伸び悩み、前年同期比13.2%の減収
- 売上低迷の影響を受け、2Q単体(7-9月)では回復基調にあるものの、上期累計では減益

売上高



営業利益（率）



要因・その他

＜製品分類別状況＞

- **機器組込製品/完成系製品**
  医療業界向けに加え、警備業界向けや金融業界向けモジュールが順調に推移、さらにシステムベンダーや鍵メーカーとの共同開発案件も増収要因となり前年同期比増収。
- **自動認識用その他**
  施工関連の売上は堅調だったものの住居関連施設向け専用タグ等の需要減少が影響し、減収。

＜利益について＞

- 減収により固定費を吸収できず、利益は前年同期比大幅減。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

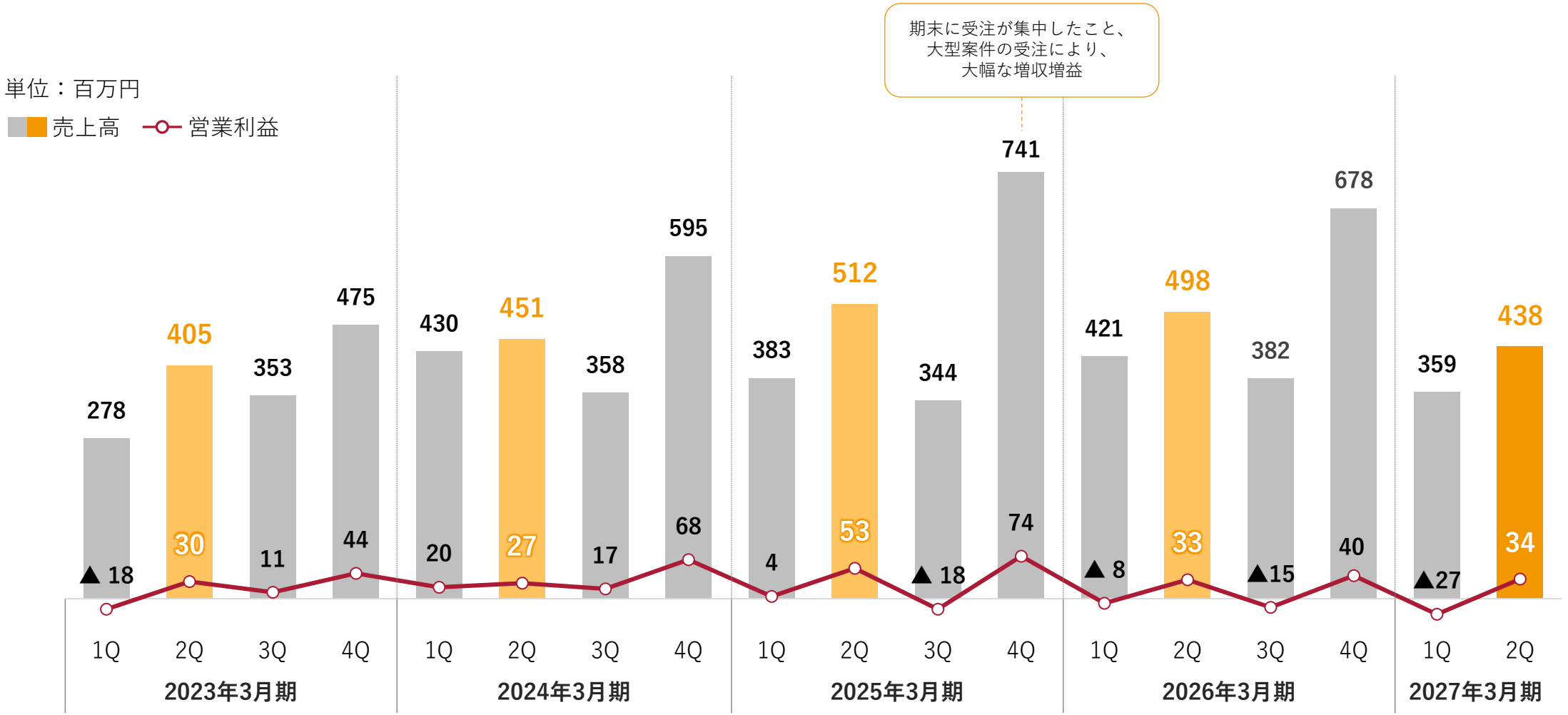
売上の伸び悩みにより販管費増を吸収できず、営業利益は減益

単位：百万円	2026年3月期2Q 実績	2026年3月期2Q 売上比率※1	2027年3月期2Q 実績	2027年3月期2Q 売上比率※1	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
売上高						
外部売上高※2	919	-	798	-	▲13.2%	▲121
内部売上高※3	35	-	36	-	+2.6%	+0
計	955	-	834	-	▲12.6%	▲120
売上原価	643	67.4%	518	62.0%	▲19.5%	▲125
売上総利益	311	32.6%	316	38.0%	+1.7%	+5
販管費	286	30.0%	309	37.1%	+8.2%	+23
営業利益	25	2.7%	7	0.9%	▲71.8%	▲18

※1 合計の売上高に対する比率
※2 外部顧客への売上高
※3 セグメント間の内部取引高又は振替高

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

売上は1Qに続き前年同期比減収。営業利益は、前年同期比増益に転じたものの中間期累計で減益



03. 業績・配当予想

2027年3月期

主に半導体事業において、当初予想を上回る水準で業績が進捗。
良好な受注環境を背景に受注残も高水準で推移する見通しから、通期業績予想を上方修正。
売上高は前期比＋12.9%、営業利益は同＋15.6%の二桁増収増益を見込む

	2026年3月期 通期実績	2027年3月期 当初予想 (26年5月13日公表)	2027年3月期 修正予想 (26年11月2日公表)	前期比		当初予想比	
				増減率	増減額	増減率	増減額
売上高	47,189	50,000	53,290	＋12.9%	+6,100	+6.6%	+3,290
営業利益	7,111	7,740	8,220	+15.6%	+1,108	+6.2%	+480
営業利益率	15.1%	15.5%	15.4%	-	+0.3pt	-	-0.1pt
経常利益	7,721	7,800	8,150	+5.6%	+428	+4.5%	+350
親会社株主に帰属する当期純利益	5,358	5,460	5,790	+8.1%	+431	+6.0%	+330

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

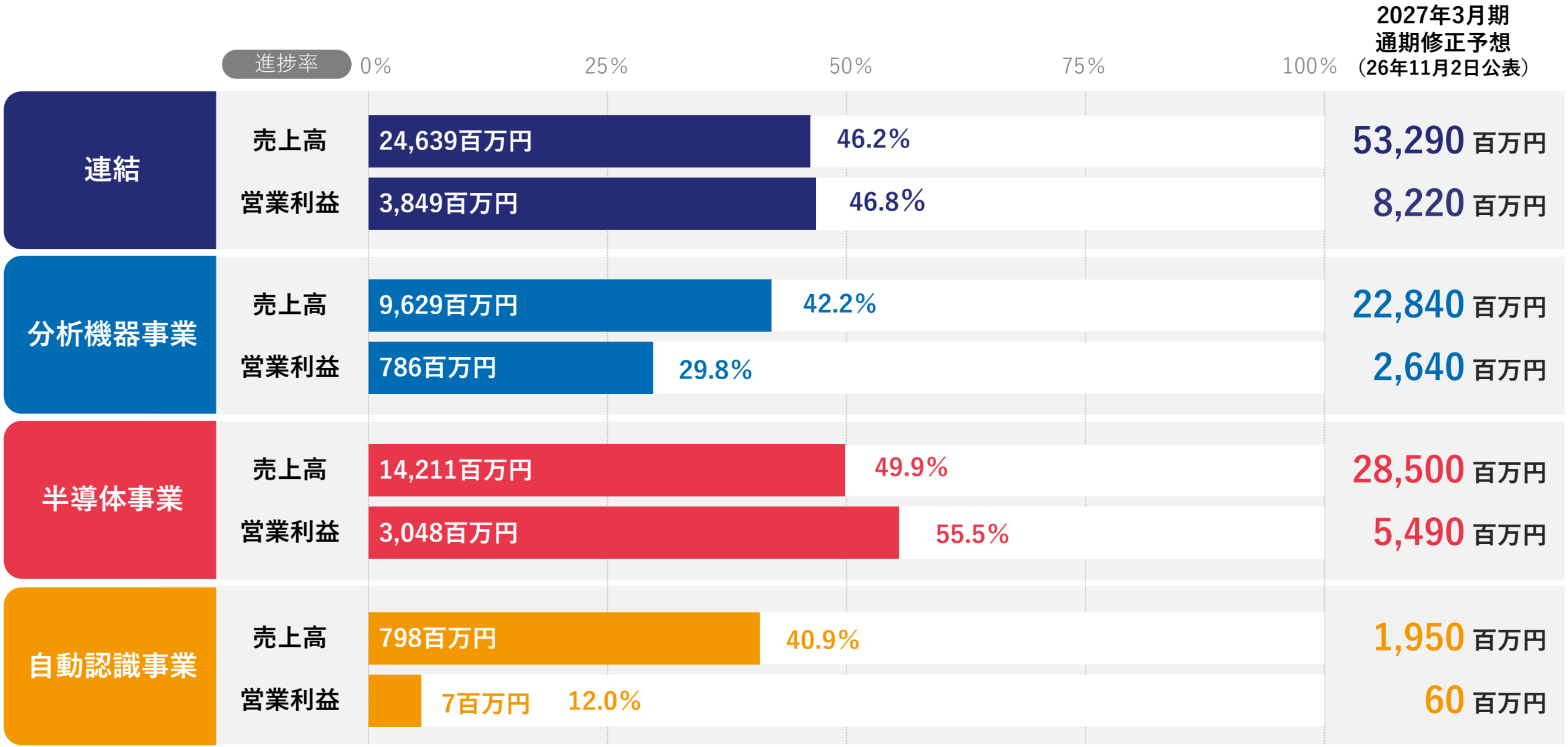
2027年3月期　セグメント別業績予想の修正

分析機器事業　下半期も引き続き自社消耗品の販売が堅調に推移し利益率が向上する見込み
半導体事業　受注残が高水準で推移する一方、人件費増やベトナム新工場の立ち上げに伴う先行費用等を見込む
自動認識事業　OEM製品群の伸び悩みは下半期も継続し、売上高、利益ともに前期並みとなる見込み

	単位：百万円	2026年3月期 通期実績	2027年3月期 当初予想 (26年5月13日公表)	2027年3月期 修正予想 (26年11月2日公表)	前期比		当初予想比	
					増減率	増減額	増減率	増減額
分析機器事業	売上高	21,549	22,500	22,840	+6.0%	+1,290	+1.5%	+340
	営業利益	2,345	2,110	2,640	+12.6%	+294	+25.1%	+530
	営業利益率	10.9%	9.4%	11.6%	-	+0.7pt	-	+2.2pt
半導体事業	売上高	23,659	25,000	28,500	+20.5%	+4,840	+14.0%	+3,500
	営業利益	4,686	5,430	5,490	+17.1%	+803	+1.1%	+60
	営業利益率	19.8%	21.7%	19.3%	-	▲0.5pt	-	▲2.4pt
自動認識事業	売上高	1,980	2,500	1,950	▲1.5%	▲30	▲22.0%	▲550
	営業利益	50	200	60	+18.7%	+9	▲70.0%	▲140
	営業利益率	2.6%	8.0%	3.1%	-	+0.5pt	-	▲4.9pt

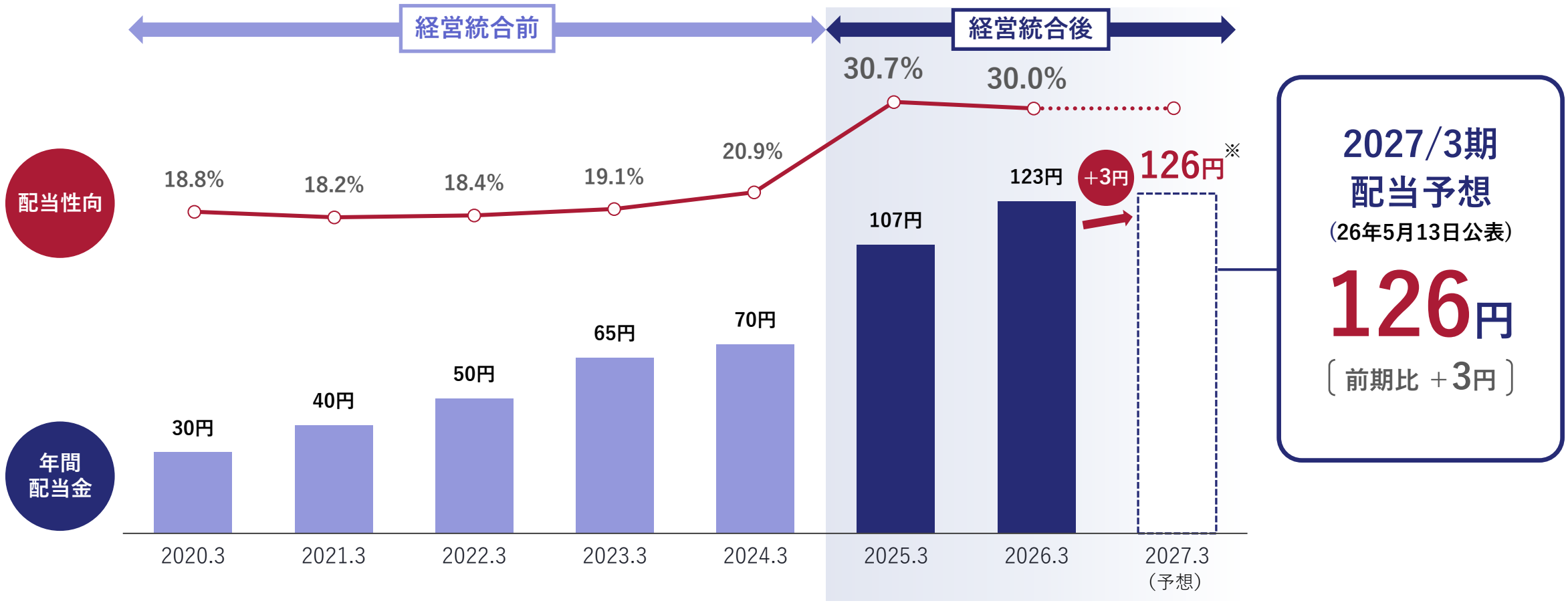
© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

通期修正予想に対する2Q累計の実績ならびに進捗状況は以下の通り



© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

通期業績予想を上方修正するも、配当予想は現時点では期初予想の126円を据え置き。
配当性向30%の方針は変更せず引き続き検討

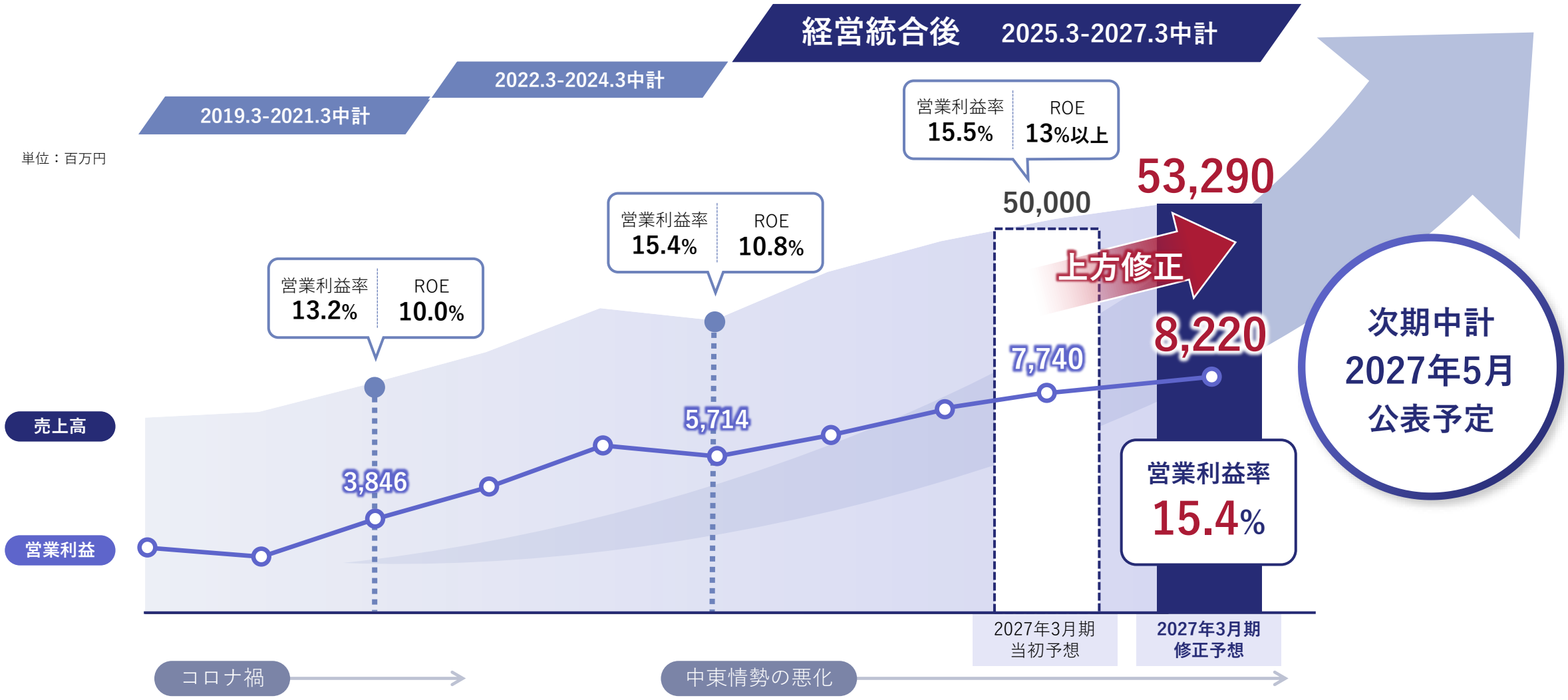


2027/3期 配当予想
（26年5月13日公表）
126円
〔前期比 +3円〕

※ 1株当たりの配当予想は、2027年3月期連結当期純利益予想及び2026年3月末時点の発行済普通株式数(13,025,870株)を基に算定

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

中計の最終年度である2027年3月期において、業績予想を上方修正。次期中計も現在策定中



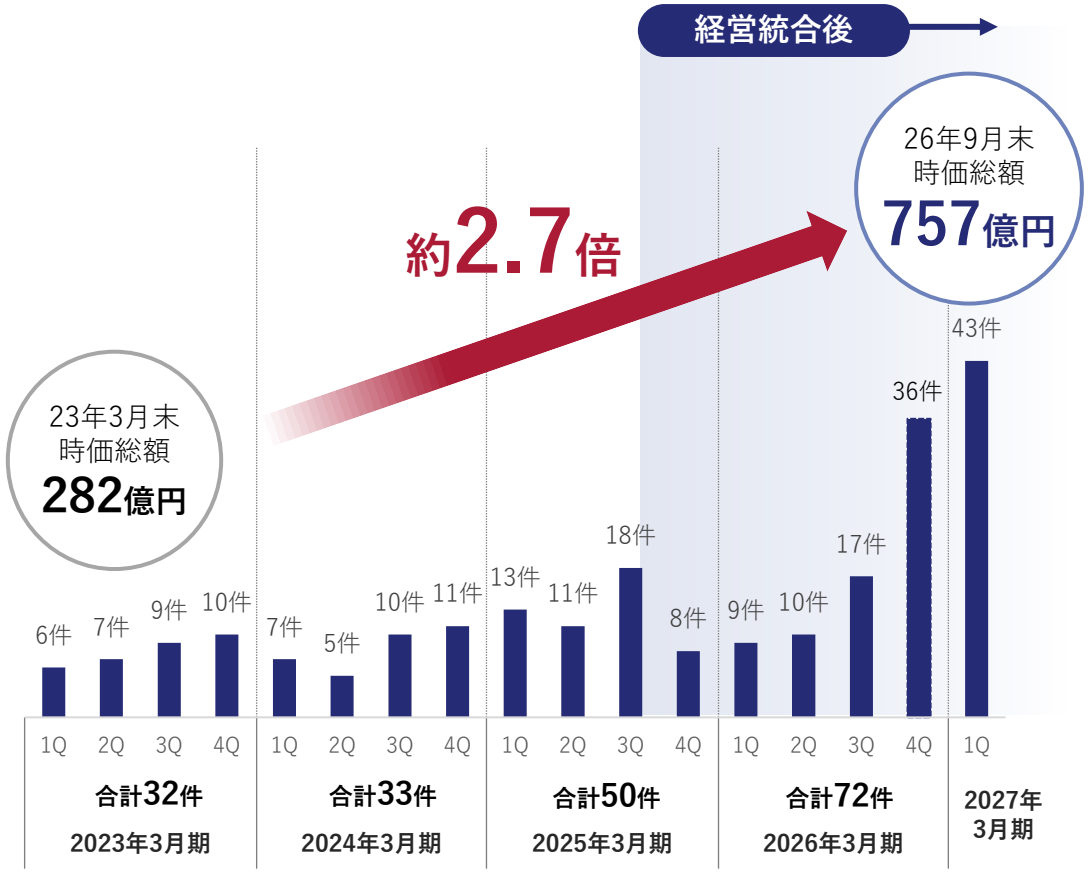
※経営統合前の2024年3月期以前は、ジーエルサイエンス株式会社の連結決算の数値を示しています。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

04. IRに関連する情報発信・取り組み

2026年3月期本決算以降、機関投資家との面談数が増加。
個人投資家を意識した取り組みにも注力し、さらなる企業価値向上を目指す

機関投資家・アナリストとの面談回数と時価総額



※各決算発表後の面談件数となります（例：1Qは１Q決算発表後の面談件数となります）

個人投資家を意識した取り組み

個人投資家向け説明会の実施　2026年8月22日(土)@東京開催





会社説明に加え、ブース展示も実施し、当社製品の実物を紹介

当日の説明動画とFAQは
こちらから

「よくわかるジーエルテクノ」ページの設置



個人投資家の皆様に向けた「3つの事業と強み」紹介ページの新設

よくわかるジーエルテクノ｜IR情報
｜ジーエルテクノホールディングス

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

05. APPENDIX

GLTECHNO HOLDINGS

1968 分析機器事業で創業
ガスクロ工業設立 ※現ジーエルサイエンス



1976 半導体事業へ進出
ガスクロ・ヤマガタ設立※現テクノクオーツ

1990～ 分析機器事業
ジーエルサイエンスへ商号変更・上場

1991～ 半導体事業
テクノクオーツへ商号変更・上場

2013 自動認識事業
ジーエルソリューションズ設立



60年近くにわたり、
時代の変化とともに事業を拡大。

2024 経営統合
ジーエルテクノホールディングス設立

経営統合により
新たな成長ステージへ。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

経営統合により、グループ内の経営資源をより戦略的に活用可能に。
2024年10月より「ジーエルテクノホールディングス」としてさらなる成長と企業価値向上を推進

GLTECHNO HOLDINGS （2024年10月設立）

経営効率の向上　最適な経営資源配分　意思決定の迅速化

ジーエルサイエンス株式会社

（1968年設立）

分析機器事業

クロマトグラフィーの技術であらゆる分析を支える

分析装置とカラムなど消耗品の企画・開発から販売・サポートまで一貫対応し、多様な産業の成分分析を幅広く支えています。


クロマトグラフィー関連消耗品


ガスクロマトグラフ


試料前処理装置

テクノクオーツ株式会社

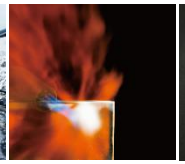
（1976年設立）

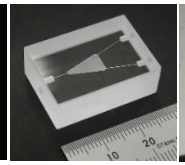
半導体事業

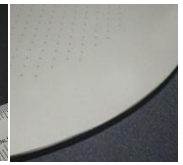
最先端の加工技術で世界の半導体製造を支える

半導体製造装置向け高純度石英ガラスと結晶シリコンパーツの製造販売を主力に、高品質なモノづくりに取り組んでいます。


機械加工


火炎加工


拡散接合


シリコン加工

ジーエルソリューションズ株式会社

（2013年設立）

自動認識事業

非接触IC カード技術でより快適な社会を実現する

非接触でICタグを読み書きする自動認識技術（RFID）のパイオニアとして、先端技術を駆使し情報化社会の進化に貢献しています。


機器組込型リーダライタ


壁付型リーダライタ


鍵管理ボックス

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

既存の枠にとらわれない価値創造に挑戦し、“社会に不可欠な技術と価値”を生み出し続ける

［ミッション］

存在意義

人と社会の可能性を触発する

ジーエルテクノグループは、創業当初より「信頼し合える仲間が集まり、人がこの世に生まれた意義を追求すること」を根本精神としており、組織の成り立ち自体が、人がもつ可能性を触発する挑戦でもあったといえます。 自らの成長のみならず、産業や社会の発展の可能性をも触発する存在でありたい。その思いは今も変わることはありません。私たちは創業の理念を受け継ぎ、その使命に向かって挑戦し続けます。

［ビジョン］

将来目指す理想の姿

枠にとらわれない自由な価値創造に挑戦する

ジーエルテクノグループは、創業より半世紀を超える歩みを重ねてきましたが、
前例や既成の事業領域に縛られることなく、グループを構成する一人ひとりが自身で思考しながら、
新しい価値創造に取り組んでいきます。

［コーポレートメッセージ］

企業メッセージ

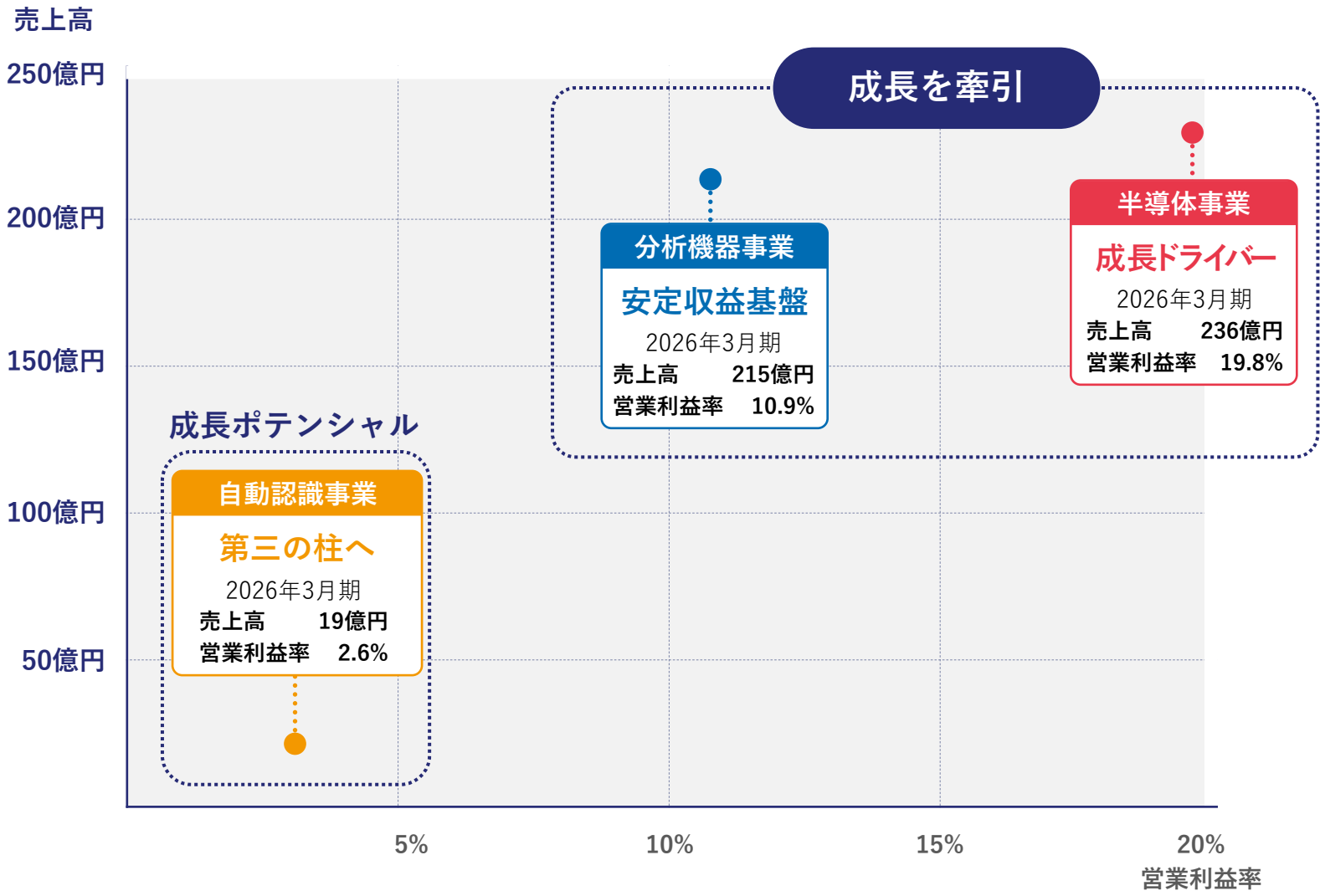
Search for a Way

次のイノベーションのそばに。

お客様のために、社会のために。そして自分たちの成長に向けて、常によりよい手段・手法を探し続けていきます。いつの時代も科学の発展と人々の暮らしを支え、社会に貢献していきます。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

“安定の分析機器事業”と“成長の半導体事業”のダブルエンジンで着実な収益拡大を目指す



分析機器事業

ジーエルサイエンス株式会社

分析装置や、その装置に欠かせないカラムなど各種消耗品の企画、開発、生産、販売、サポートまでを一貫対応

Point 景気の波に左右されにくく堅実に成長

半導体事業

テクノクオーツ株式会社

半導体製造装置用の高純度石英ガラスと結晶シリコンパーツを主力とした半導体関連製品の製造・販売

Point 半導体製造装置の稼働量と急伸を背景に大きく成長

自動認識事業

ジーエルソリューションズ株式会社

ICタグの情報を非接触で読み書きする「自動認識技術(RFID)」のパイオニア企業として、関連製品を製造・販売

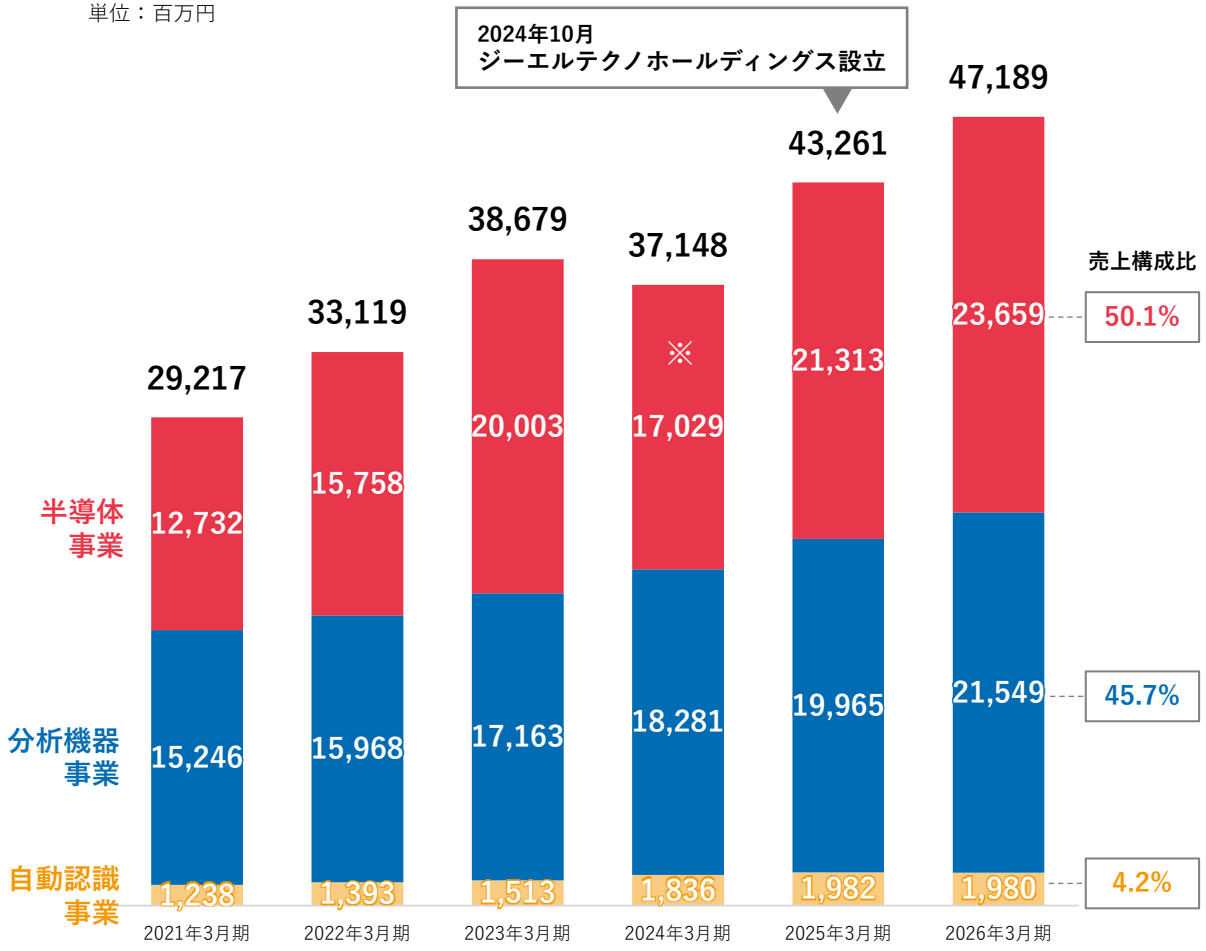
Point IoTが各分野に浸透していく中でニーズが拡大

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

社会を支える３つの事業で実現している堅実な経営基盤と収益性の成長性

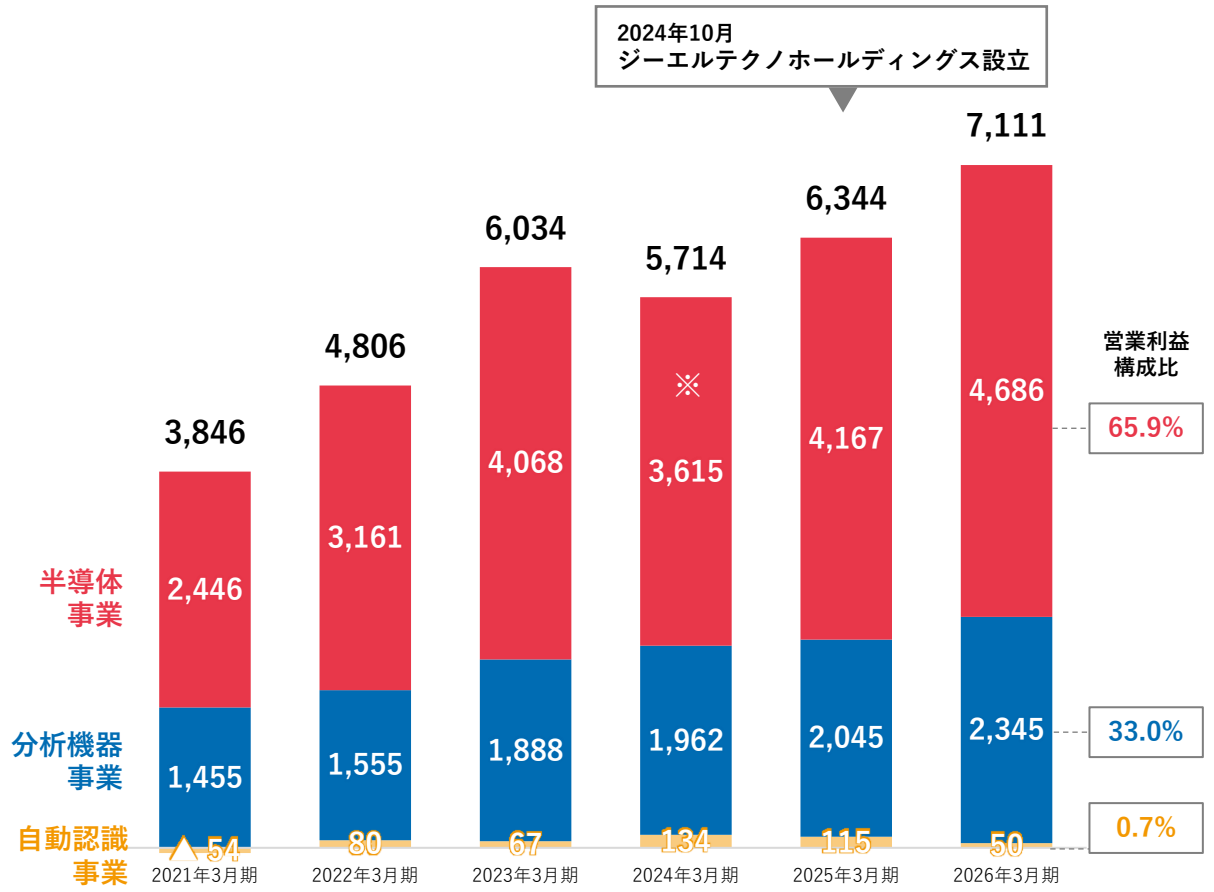
セグメント別【売上高】推移

単位：百万円



セグメント別【営業利益】推移

単位：百万円



※ 2024年3月期 半導体事業売上高は、パソコンやスマートフォン向け需要の減退に伴うメモリ在庫の停滞の影響で減収減益

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

分析機器事業

用語	解説
クロマトグラフィー	混合物に含まれる複数の成分を、それぞれの性質の違いを利用して分離・測定する分析技術。 食品、医薬品、環境、化学など幅広い分野で利用される。
カラム	クロマトグラフィーにおいて、試料中の複数の成分を分離するために使用する管状の部品。 分析精度を左右する重要な消耗品であり、使用状況に応じて交換需要が発生。
ガスクロマトグラフ（GC）	気体(キャリアガス)を用いて試料(分析サンプル)をカラムへ送り、含まれる成分を分離・測定する分析装置。 主に、気化しやすい物質の分析に使用される。
液体クロマトグラフ（LC）	液体を用いて試料をカラムへ送り、成分を分離・測定する分析装置。 主に気化しにくい物質や熱に弱い物質の分析に使用される。
質量分析計	試料中の成分をイオン化し、質量電荷比の違いを利用して、物質の種類や量を高感度に測定する分析装置。 微量成分の特定や定量に優れ、医薬品、食品、環境分析など幅広い分野で使用される。
試料前処理	測定前に試料をろ過、濃縮、精製、抽出などして、分析しやすい状態に整える工程。 測定結果の精度や再現性を左右する、重要な分析工程。
固相抽出	固体の吸着材を利用して、試料中の目的成分の濃縮や、分析を妨げる成分の除去を行う試料前処理法。 分析精度の向上や分析装置や消耗品の保護に役立つ。
固相抽出カートリッジ	固相抽出に用いる吸着剤を充填したカートリッジ型の消耗品。 目的成分の濃縮や分析を妨げる成分の除去を行う前処理用消耗品。
PFAS	ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の略称。 炭素とフッ素を含む化合物。 難分解性、高蓄積性等の性質があるため、国内外で規制やリスク管理が進んでいる。
キャリアガス	ガスクロマトグラフを使用するために必要な、気化した試料をカラムへ運ぶためのガス。 主に、ヘリウム、水素、窒素、アルゴンが使用される。
他社製品	国内外のメーカーから仕入れ、当社が販売する分析装置、周辺機器、消耗品などを指す。 自社製品と組み合わせることで、顧客の分析目的や設備環境に応じた最適かつ幅広い提案が可能。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

半導体事業

用語	解説
高純度石英ガラス	金属不純物などの含有量が極めて少ない、二酸化ケイ素（SiO_2）を主成分とするガラス。 耐熱性や耐薬品性に優れ、半導体製造装置の部材として使用される。
半導体製造装置	シリコンウェーハ上に回路を形成し、半導体チップを製造するための各種装置。 装置内部では高温環境や腐食ガスに曝されるため、高純度石英ガラス部材が使われる。
半導体用石英ガラス治具	半導体製造工程で、ウェーハを保持・搬送・処理するための石英ガラス製の部材。 高い光透過性や耐熱性が求められる。
機械加工	マシニングセンタなどの精密加工機を駆使し、 研削や穴あけによって石英・シリコンを所定の形状や表面状態に仕上げる工法。
火炎加工	高温の火炎で石英ガラスを軟らかくし、接合、曲げ、成形などを行う加工方法。 複雑な形状の製品には熟練した技術が必要だが、近年では自動化が進んでいる。
インゴット	製品加工前の塊状または棒状の素材。半導体向け部材の主要原材料。
開発品	当社における製品区分のひとつ。顧客の要求や将来用途に向けて試作・評価を行うための製品。 量産採用に至ると継続的な売上につながる。
量産品・リピート品	当社における製品区分のひとつ。顧客との共同開発や試作・評価を経て採用され、契約後に継続して生産・納入する製品。 採用後は同一仕様で繰り返し受注されるため、安定的な売上につながる。
半導体デバイスメーカー	メモリー、ロジック、センサーなどの半導体デバイスを製造するメーカー。 設備投資動向やその稼働量が装置部材需要に影響する。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

自動認識事業

用語	解説
RFID	Radio Frequency Identificationの略。電波や電磁波を使って、ICカードやICタグに記録された情報を非接触で読み書きする技術。入退室管理や物品管理、在庫管理など利用される。
機器組込製品	当社製品区分のひとつ。 顧客のさまざまな用途の製品に対し、RFID機能を付加する部品として提供する基板形状のリーダライタ製品群。
完成系製品	当社製品区分のひとつ。 ケースに組み込まれそのままシステムとして構成できる状態で出荷されるリーダライタ製品群。
ICタグ	ICチップとアンテナを組み合わせた小型の記録媒体。 商品や物品などに取り付け、識別情報や管理情報を非接触で読み書きするために使用される。
システムソリューション	当社製品区分のひとつ。自社のRFID機器に、各種機器やアプリケーションを組み合わせ、顧客の管理・認証業務を支援するシステムとして提供する製品群。入退室・勤怠管理、鍵管理、化学物質管理などを展開している。
リーダライタ	ICカードやICタグに記録された情報を読み取り、必要に応じて情報を書き込む装置。 RFIDシステムの中心となる機器。
NFC	Near Field Communication（近距離無線通信）の略。スマートフォンやICカードなどを数センチ程度の距離で通信させる非接触技術。決済、本人確認、入退室管理などに使用される。
入退室管理システム	ICカードやスマートフォンなどで利用者を認証し、扉の施錠、解錠や入退室履歴を管理するシステム。 リーダライタ単体だけでなく、管理ソフトや周辺機器を含めた提案機会につながる。
電子パスポートリーダ	電子パスポートに内蔵されたICチップと券面情報から、本人情報や顔画像などを読み取る装置。 本人確認や国際的な身分証明の確認に使用される。
鍵管理ボックス	鍵を保管し、ICカードなどによる認証で貸出・返却を管理する装置。利用者や利用履歴の記録が可能。

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

主に「前工程」で使用される消耗品の製造・販売

ウエハ製造 ▶ **酸化・成膜** ▶ 露光 ▶ **エッチング** ▶ 回路形成 ▶ 後工程

半導体製造装置



装置の内部部品



薬品・高温など
過酷な環境
▼
消耗が激しい

売上の約8割が
消耗品のストック型ビジネス

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

新たな半導体製造プロセスに合わせた開発から始まり、厳しい性能評価と品質要求への対応を経て当社製品が採用された後は、長期にわたる安定的なリピート需要へ

新規開発品

図面・仕様検討 → 価格・納期提示 → サンプル提出 → 契約

半導体の需要動向や設備投資動向に連動したリピート需要、定期的な消耗品交換需要が発生



リピート需要 →  安定収益の積み上げ

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

国内5拠点、海外2拠点の、計7拠点に展開

	テクノクオーツ株式会社				アイシンテック株式会社	杭州泰谷諾石英有限公司	TECHNO QUARTZ VIETNAM CO., LTD.
生産拠点	蔵王工場	蔵王南工場	蔵王西工場	山形工場	アイシンテック	中国	ベトナム
	山形県山形市	山形県山形市	山形県山形市	山形県山形市	福島県喜多方市	浙江省	ニンビン省
従業員数※	152名	110名	6名	13名	45名	282名	ー
敷地面積	22,243㎡	28,858㎡	4,958㎡	5,610㎡	14,720㎡	約16,528㎡	27,475㎡
主要加工方法	火炎加工	機械加工 ※新棟は火炎加工	機械加工	材料加工 ※インゴットの切断	機械加工 ※自動化ライン増設	機械加工 ※一部火炎加工	機械加工

※ 2026年3月末時点

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

装置メーカーが求める厳格な品質基準や、難易度の高い特注品にも対応可能な加工技術が強み

素材に合わせてスピードやパワーを細かく調節し、
幅0.01mmの世界で機械の動きを制御しながら加工に応じたプログラムを設計

素材



機械加工



火炎加工



検査

洗浄

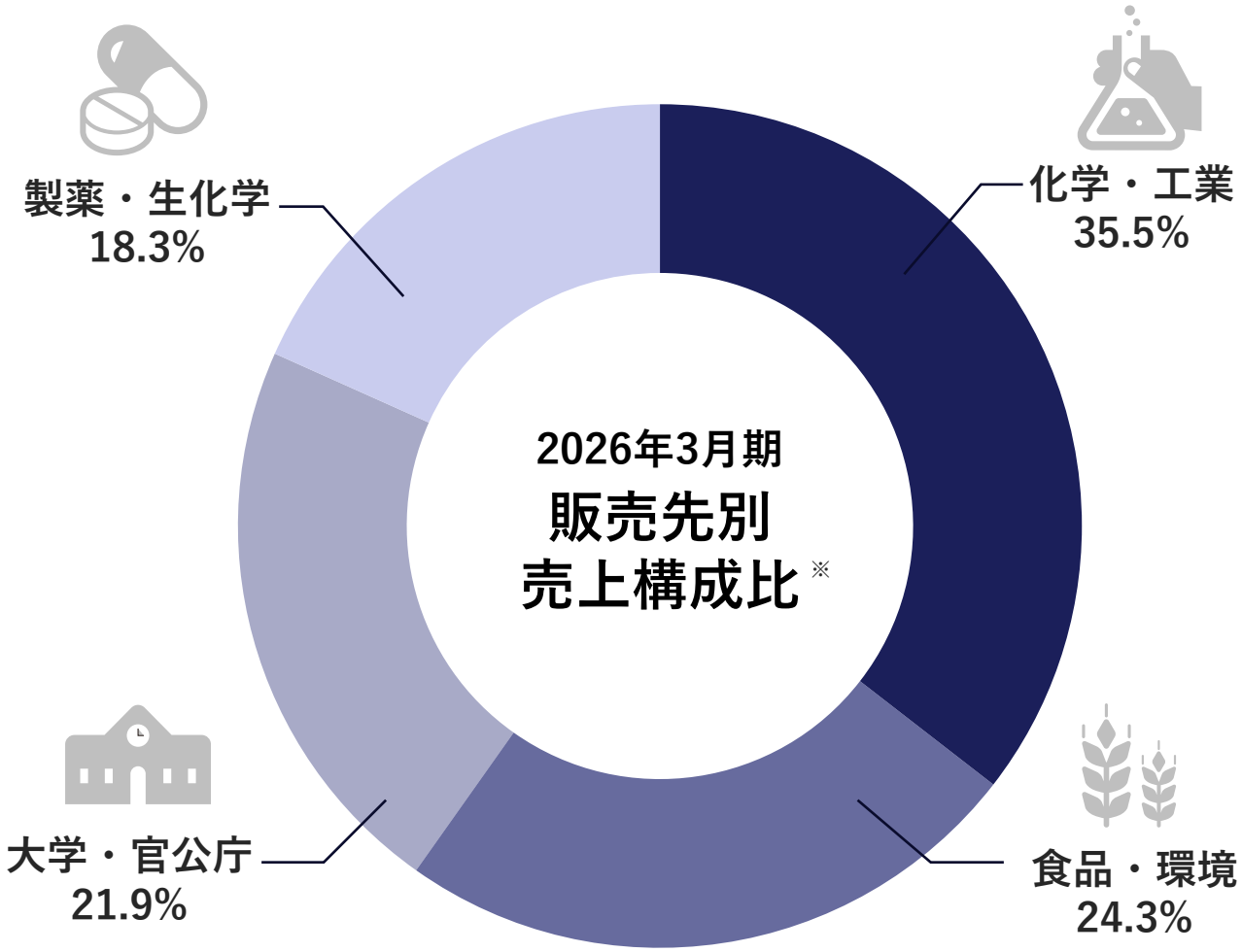
梱包

石英ガラスは耐熱性に優れており、
成形加工に必要な温度は2,000℃ 以上。
長年培ってきた知識と経験で、
精巧な仕上がりを実現

技術・品質が高く評価され、大手半導体装置メーカーから認証を取得

© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

当社の安定的成長を支える分析機器事業は、幅広い分野で社会に貢献



多種多様な顧客基盤



※ジーエルサイエンス株式会社単体の日本国内向け販売先別売上構成比



GLTECHNO HOLDINGS

ジーエルテクノホールディングス株式会社
〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1
TEL ： 03-4212-6677
URL ： https://www.gltechno.co.jp

免責事項

本資料には、将来に関する業績の見通しを含みますが、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々なリスクや不確定要素に左右されるため、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。
本資料の著作権は、ジーエルテクノホールディングス株式会社に帰属します。
事前の承諾なしに著作物を使用することはできません。